数結晶粒よりなる微細すず試験片のひずみ測定と 有限要素法を用いた変形挙動解析

鹿児島大学 理工学研究科 機械工学専攻 修士2年 柳瀬 篤志

1. 緒言

近年, SnAgCu などの鉛フリーはんだ合金がはんだ材と して用いられているが、その主成分はβ-Snである.β-Snは、 複雑な正方晶構造を有するため、結晶特性やすべり系の数 など十分に明らかになっていないのが現状である.また、 電子機器の小型化に伴い、はんだ接合部のサイズは数+μm のオーダーに達している.そのため、はんだ接合部内は 1 個もしくは数個程度の結晶粒から構成されるため個々の結 晶粒の特性を考慮した強度評価が必要になっている.そこ で、本研究では微細すず試験片を用いて引張試験および Hillの異方性弾塑性論、結晶塑性論を用いたFEM(有限要素 法)解析を行い異方性の影響を検討し、定量的・定性的に評 価する手法を確立することを目的とした.

2. 実験方法および解析手法

論文に記載しているため省略.

3. 実験&解析結果および考察

3-1 応力-ひずみ曲線

実験により得られた応力-ひずみ曲線と FEM(Hill)解析よ り得られた応力-ひずみ曲線を図 1(a)に示す.また,結晶塑 性解析から得られた応力-ひずみ曲線を図 2 に示す(計算の 都合上A,B,Cのみ).図1より,試験片Fが特に大きな降伏 応力を示し,試験片 E が最小となった.結晶方位や結晶粒 数の影響により降伏応力には 4~9MPa,引張強度で 2 倍の 差が生じている.解析モデルでは E の見かけの降伏応力が 最大となった.また,試験片 G は FEM の結果と一致してい るがそれ以外の試験片は異なる結果となり,FEM(Hill)では 加工硬化が起きている.図1(b)よりモデルA は実験結果に 比べ,降伏応力に差があるが公称ひずみ7.5%時の応力は近 い値を示した.モデルB,Cは降伏応力に2倍ほど差がある. すべてのモデルで加工硬化が起きており,結晶粒拘束硬化 が働いたと考えられる.

3-2 活動すべり系と分解せん断応力

引張試験を行った試験片において最初に活動した結晶粒 を DICM 計測により特定し、その結晶粒の活動すべり系を 検討した.最初に活動した結晶粒の活動すべり系と図 1 で 計測した降伏応力から各すべり系の臨界分解せん断応力 τ_0 を算出した. β -Sn の活動すべり系と臨界分解せん断応力は、 最初に活動した結晶粒の結晶格子、EBSD 解析より取得し た面方位、すべり線との兼ね合いから推定した.表 1 は本 研究で算出した臨界分解せん断応力と文献値を比較したも のでありほぼ近い値を示している.すべり系によって臨界 分解せん断応力に差が生じたのは結晶粒の形状、大きさ、 結晶方位の組み合わせによって変形の様子や降伏応力が変 わってくるためだと考えられる.

3-3 DICM 計測と FEM 解析結果

図2は試験片A,Bの金属顕微鏡で観察した引張試験後の 画像,DICM および FEM(Hill),結晶塑性解析によるひずみ 分布結果である.紙面の都合上試験片A,Bの結果のみ示す. すべり変形が起こった結晶粒と起こっていない結晶粒が存 在し、すべり線が観察された結晶粒にひずみが集中してい る.DICM と FEM 解析結果より試験片 A,B それぞれ FEM(Hill)はDICM 結果と一致しておらず,Sn は直交異方性 ではないため一致しなかったと考えられる.一方,結晶塑 性解析と比較すると、モデルAはDICM結果と定性的に一 致し、Bは異なる結果となった.今回考慮したβ-Snのすべ り系は5つであるため、変形を予測できるものとそうでは ないものがあったと考えられる.FEM(Hill)解析でひずみ分 布が一致していなかった試験片が結晶塑性解析では一致し ているものも存在するため、他のモデルでもひずみ分布が 一致するのではないかと考えられる.しかし、解析精度は 低いため今後すべてのすべり系を考慮しての結晶塑性解析 を行う必要がある.

4. 結言

本研究では、数結晶よりなる微細すず試験片の引張試験 および FEM 解析を行い、以下のことが明らかになった.

- β-Sn の数結晶構造において異方性の影響は消失せず、 変形に強く依存する.また、臨界分解せん断応力はす べり系ごとに顕著な差がある.
- 2) FEM(Hill)解析では β-Sn は直交異方性ではないため一 致しなかったと考えられる.一方,結晶塑性解析では 定性的に一致するモデルもあるため,FEM(Hill)解析よ りも変形を予測するのに効果的であることを示唆して いる.



Fig. 1 Stress-Strain curves of the experiment and FEM ((a) is FEM (Hill) and (b) is CPFE method).



Fig. 2 Microphotographs taken by an optical microscope (top), distributions of equivalent strain measured by the DICM (mid), and calculated by the FEM (bottom).

Table 1	Critical	resolve	ed shear	stress, τ_0 .	
---------	----------	---------	----------	--------------------	--

ruble i Cilifeat fesoritea shear stress, to				
Slip system	τ_0 (MPa)	Reference ⁽¹⁾		
{100} < 011 >	3.31	3.80		
{110} < 001 >	1.10	1.30		
$\{110\} < 1\overline{1}1 > /2$	2.50	2.30		
$\{101\} < 10\overline{1} >$	1.90	1.60		
$\{211\} < 0\overline{1}1 >$	2.26	1.70		

参考文献

M. A. Matin, et al. Microstructure evolution in a Pb-free solder alloy during mechanical fatigue, Materials Science and Engineering A 431, (2006), pp. 166-174.